

日時

令和7年6月19日(木) 13:30~16:30

場所

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部 (神奈川県海老名市下今泉705-1 小田急線・相鉄線・JR相模線の海老名駅から徒歩15分)

講師

黒内 正仁(神奈川県立産業技術総合研究所 電子技術部)

実習内容

電子線描画装置によるレジストへのナノパターンの形成の実習を行います。

実習機器

日本工学会

ECEプログラム認定

電子線描画装置 (株)エリオニクス製 ELS-S50

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムでは、川崎市、 KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ 産学官共同研究施設「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。 今回は、KISTECの設備・装置を使った実習を行います。

定員:先着5名 参加費:13,000円(税込、テキスト代込)

※川崎市中小企業に対する、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金の適用はございません。

主催:4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所、川崎市



問い合わせ先

(地独) 神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部 Tel:046-236-1500(代表) 技術担当 菅間 電子技術部 / E-mail: sugama@kistec.jp

| 技術担当 管间 | 電子技術部 / E-Mail: Sugama@kistec.jp | 事務担当 | 人材育成部 / E-mail: sm_sangyoujinzai@kistec.jp